DE003122352A1 PUB-NO:

DOCUMENT-IDENTIFIER: DE 3122352 A1

TITLE: High-back-resistance planar

semiconductor component with

lacquer coating

PUBN-DATE: January 13, 1983

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY DF.

MEINDERS, HORST DIPL PHYS

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY NAME

N/A MEINDERS HORST DIPL PHYS

APPL-NO: DE03122352

June 5, 1981 APPL-DATE:

PRIORITY-DATA: DE03122352A (June 5, 1981)

INT-CL (IPC): H01L029/86, H01L029/72 , H01L029/74

EUR-CL (EPC): H01L029/06; H01L029/06, H01L029/06

US-CL-CURRENT: 257/495, 257/629 , 257/E29.013 , 257/E29.015

, 257/E29.017

ABSTRACT:

CHG DATE=19990617 STATUS=O> A planar

high-back-resistance diode, or a

semiconductor component containing at least one such diode is proposed. In

addition to the usual terminal electrodes, the diode also

contains narrow metal strips which are applied to the oxide on top of the high-resistance zone of the p-n junction. The metal strips have to be positioned in such a way that they do not affect the spread of the space-charge zone when a reverse voltage is applied. For this reason, they should be situated if possible outside the space-charge zone on the high-resistance part of the p-n junction. Coating planar high-back-resistance diodes with lacguer for the purpose of passivation has hitherto presented substantial difficulties. The charges impressed on the silicon dioxide/lacquer boundary surface by the lacquer migrate under the influence of temperature and electrical surface fields. This ion migration results in polarisation at the surface of the lacquer-coated p-n junction, as a result of which the breakdown characteristic is impaired or destruction even takes place. The proposed metal-ring system acts as a barrier to this ion migration. Diodes having such rings exhibit virtually no change in their blocking properties after a hot reverse test (150 DEG C. 400 V, 20 hours). As a result failures can be completely avoided.

DEUTSCHLAND

® BUNDESREPUBLIK ® Off nl gungsschrift

_® DE 3122352 A1

H 01 L 29/86

(5) Int. Cl. 3:

H 01 L 29/72 H 01 L 29/74



DEUTSCHES

(21) Aktenzeichen: Anmeldetsa: (3) Offenlegungstag: P 31 22 352.4 5. 6.81 13. 1.83

PATENTAMT

(7) Anmelder:

Meinders, Horst, Dipl.-Phys., 7410 Reutlingen, DE

(72) Erfinder: gleich Anmelder



6 Hochsperrendes, planares Halbleiterbauelement mit Lackebdeckung

Ei wird eine planare, hochsperrende Diode, oder ein habtetehsaulement, welches mindestens eine solche Diode enthält, vorgeschiegen, welche zusätzlich zu den üblichen Anschlüßelschreiden noch schmaße Metallstrellen enthält, die auf dem Odd über der hochohmigen Zone des pr-Übergarsen gelten sin die Metallstrellen missens no positioniert auf der Schmaßen sin der Metallstrellen missens no positioniert sin der Schmaßen der Raumladungszone auf dem hochohmigen Tall des pr-Überganges befinden. Es bereitet bieher große Schwiedigslehten, planare hochsperende Dioden zur Passilvierung mit Leck abzudecken. Die durch den Ladungen wachen unter dem Einfluß von Temperatur und elektrischen Oberflächenteidern. Diese lonenwanderung führt zu Polasisationen an der Oberfläche des lacktabgedeckten pr Es wird eine planare, hochsperrende Diode, oder ein zu Polarisationen an der Oberfläche des lackabgedeckten pnzu rusinsationen an der Gover auch de lackaugedekken pri Überganges, wodurch eine Verschlechterung der Durch bruchskennlinie oder gar die Zerstörung erfolgt. Das vorge-schlagene Metaltringsystem wirkt als Barrière gegen diese lonenwanderung. Dioden mit solchen Ringen zeigen fast keine Veränderung ihrer Sperreigenschaften nach einem Hot Reverse Test (150° C, 400 V, 20 Std.). Ausfälle können hierdurch vollkommen vermieden werden.

- Halbleiterbauel ment, vorzugsweise mit n-l itendem Silizium als Halbleitergrundsubstanz (1) mit mindestens einem mit dem Halbleiteroxid (3) als Diffusionsmaske planar h rgestellten pu-Übergang (2), dadurch gekennz ichn t, daß sich auf dem Halbleiteroxid (3) über dem nicht diffundierten Halbleitergrundsubstrat (1) mindestens ein geschlossener Metallstreifen (4) befindet, der parallel um die diffundierte p-Wanne herum verläuft.
- 2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der pn-Übergaug (2) zusätzlich zum Metallstreifen (4) noch einen oder mehrere p*-Petentialringe (5) aufweist.
- 3. Halbleiterbauelement nach Amspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Metallstreifen vorzugsweise so positioniert ist, daß die Ausbreitung der Baumladungszone (6) in die n-Zone (1) bei einer geforderten Sperrspannung der Diode kleiner ist, als der Abstand der Metallinnenkante vom pn-Übergang.
- 4. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallstreifen (4) keinen elektrischen Kontakt mit dem unter dem Oxid vorhandenen Halbleitermaterial (1) haben.
- 5. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallstreifen (4) durch ein Kontaktfenster in Oxid entweder an einer Stelle, oder auf dem ganzen Umfang mit dem unter dem Oxid vorhandenen Halbleitermaterial (1) elektrisch verbunden eind.
- Halbleiterbauelement nach den Ansprüchen 1-5 dadurch gekennzeichnet, daß eine planere, hochsperrende Diode mit einem solchen Metallringsystem versehen wird.
- 7. Halbleiterbauelement nach den Ansprüchen 1-5 dadurch gekennzeichnet, daß der planare, hochsperrende Basis-Kollektor-Übergang eines num-Transistors mit einem solchen Metallringsgetem wersehen ist.
- 8. Halbleiterbauelement nach den Ansprüchen 1-5 dadurch gekennzeichnet, daß es sich um einen halbplanaren, hochsperrenden Thyristor handelt, bei dem der kathodenseitige in Kipprichtung hochsperrende pm-Dbergang planar hergestellt wird und in der in den Ansprüchen 1-5 definierten Weise mit einem System von Metallstreifen versehen int.

Di Amm ldung betrifft eine planare, hochsperrende Diode nach der Gattung des Hauptanspruches. Es kann sich ab r auch um ein Halbleiterbauel ment handeln, welches unter anderem eine planar , hochsperrende Diode als Komponento aufweist, zum Beispiel ein nym-Transistor oder ein halbplanarer Thyristor mit einem planaren kathodenseitigen hochsperrenden pn-Übergang. Um die Dioden solcher Halbleiterbauelemente, welche mehrere hundert Volt und manchmal mehrere KV sperren sollen, zu passivieren, ist es notwendig, die Bauelemente mit Lack abzudecken. Dabei müssen an die Lackqualität ganz extreme Forderung gestellt werden:

- Durch den aufgetragenen Lack darf das Sperrvermögen der Diode nicht beeinflußt werden.
- Der Lack muß nach der Polymerisation elastisch bleiben, um die Halbleiteroberfläche keinen mechanischen Spannungen gwegliedten.

Umfangreiche Untersuchungen haben ergeben, daß es keine einzige Lacksorte gibt, welche auf herkömmliche planare Diodenstrukturen aufgetragen werden kann, ohne daß sich im Laufe eines Hot-Reverse-Testes eine Verschlechterung der Sperreigenschaften der Diode ergibt.

Die Anfgabe dieser Anmeldung besteht darin, eine Diodenanordnung anzugeben, bei der die schädliche Wirkung der durch den Lack auf das Oxid aufgebrachten Ladungen weitgehend vermieden wird. Hierzu werden erfindungsgemäß Metalletreifen, die im Prinzip beliebig schmal sein dürfen, auf auf dem Oxid über den hochohmigen D-Gebiet angebracht.

Figur 1 zeigt die Anwendung des Erfindungsgedankens auf eine planare Diodenstruktur, oder den Basis-Kollektor-Übergang eines hochsperrenden nym-Transistore. In dem hochohmigen n-Gebiet (1) mit einer Dotierung zwischen 5·10¹⁵ und 5·10¹⁵/cm⁵ befindet sich der pn-Übergang (2). Die Oxidschicht (3) kann mit einer Lackschicht überzogen werden.

Figur 2 zeigt die Anwendung auf eine planare hochsperrende Diodenstruktur, bei der zur Vergrößerung der Sperrfähigkeit ein p-Potentialring (5) eingezogen wurde, der die p-dotierte Wanne konzentrisch umschließt.

Figur 3 zeigt die Randstruktur eines halbplanaren Thyristors – die hochdotierte Kathodenzone wurde weggelassen. Hier ist der kathodenseitige in Kipprichtung hochsperrende pn-Übergang planar hergestellt und zur Vergrößerung der Sperrfähigkeit mit einem p-Potentialring (5) versehen worden. Der anodenseitig sperrende pn-Übergang (7) ist zur Vermeidung des Oberflächendurchbruches mit einem Schliff angephast worden.

Den Strukturen in den Figuren 1-3 ist gemeinsam, daß die p-Wanne konzentrisch von einem Metallring (4) umschlossen wird, Die Wirkung dieses Metallringes kann am besten verstanden werden, wenn man ihn sich zunächst wegdenkt. Die durch den Lack auf die Oxidoberfläche aufgebrachten positiven und negativen Ladungen sind zunächst wegen der Ladungsneutralität gleich verteilt. Unter dem Einfluß von Temperatur und anliegender

Sperrspannung wandern die positiven Ladungen zur p-Zone und die negativen Ladungen zur hochohmigen n-Zone. Dies negativen Ladung ne rezugen unter dem Oxid (3) positive Spieg lladungen, di das n-Gebiet an dr Kristall-oberfläche hochohmiger werden lassen und somit zu ein m Herauswand rn der Grenze der Raumladungszon (6) in das n-G biet führ n. Dieses Herauswand rd dr der Raumladungszone bewirkt ein Anwachsen (walk out) der Durchbruchskennlinie. Dieser Walk out Effekt ist außerordentlich unerwünscht, denn die Raumladungszon kann sich bis an den Raum (Ritzgraben) des Bauelementes ausdehnen. Die Durchbruchskennlinie springt dann auf geringe Spannungswerte zurück und das Bauelement wird zerstört

Bei Verwendung eines Metallringes (4) wandern die negativen Ladungen bis an die innere Ringkante. Die Raumladungezone kann sich also bis an diese Ringkante ausdehnen. Wirde sie jedoch weiter ausufern und an der äußeren Ringkante wieder hervortreten, so befände sich der Metallring auf negativerem Potential, ale das jetzt von der Raumladungszone erfaßte Silizium. D.h. es würden positive Ionen an die Metallaußenkante wandern, und durch ihre negativen Spiegelladungen den weiteren Ausdehnungsvorgang der Raumladungszone verhindern.

In ähnlicher Weise wirkt ein breiter Metallstreifen, der bis an den Ritzgraben reicht. Das positive Potential dieses Metallstreifens zieht negative Spiegelladungen unter dem Oxid an der Siliziumoberfläche an, die ein Stoppen und Auflaufen der Raumladungszone bewirken.

Will man ganz sicher gehen, so kann der breit ausgeführte Metallstreifen auch noch mit einem Kontaktfenster im Oxid an das Potential des Siliziums im Ritzgraben augeschlossen werden. Ein gravierender Unterschied im Sperrverhalten nach dem Hot-Reverse-Test ergibt sich jedoch zwischen angeschlossenen und nicht angeschlossenen Metallringen nicht.

8

. .

